

## РАЗОГРЕВ ИЗЛУЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОНОВ И ВРЕМЯ НЕУПРУГОГО ЭЛЕКТРОН–ФОНОННОГО РАССЕЯНИЯ В СОЕДИНЕНИИ YBaCuO

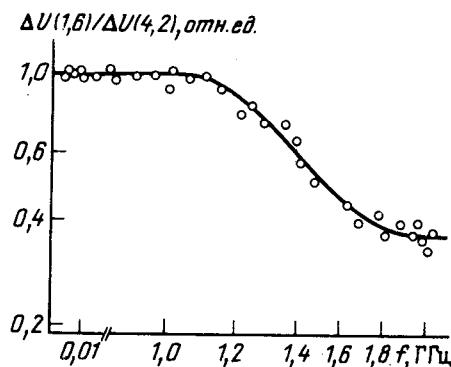
Е.М.Гершензон, М.Е.Гершензон, Г.Н.Гольцман,  
Б.С.Карасик, А.Д.Семенов, А.В.Сергеев

Впервые измерено время энергетической релаксации электронов за счет электрон-фононного взаимодействия в пленках высокотемпературного сверхпроводника YBaCuO. Результаты свидетельствуют о существенном усилении электрон-фононного взаимодействия в этом соединении по сравнению с обычными сверхпроводящими металлами.

Время энергетической релаксации электронов  $\tau_{eph}$  за счет электрон-фононного взаимодействия (ЭФВ) является одним из фундаментальных параметров сверхпроводника, определяющим его свойства в неравновесном состоянии и отражающим интенсивность ЭФВ. Исследование  $\tau_{eph}$  может дать ценную информацию о природе высокотемпературной сверхпроводимости и является важным для определения предельно достижимых характеристик ряда криоэлектронных устройств.

Нами исследовалась энергетическая релаксация электронов в пленках соединения YBaCuO путем измерения времени остывания электронной подсистемы  $\tau$  при воздействии излучения

на сверхпроводник, находящийся в резистивном состоянии. Ранее этот метод применялся для определения  $\tau_{eph}$  в тонких пленках Nb и Al<sup>1</sup>. Использовались пленки состава  $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-x}$ , полученные высокочастотным магнетронным распылением керамической мишени в атмосфере аргона на подложки из поликристаллического лейкосапфира. Толщина пленок  $d$  варьировалась от 0,3 до 1 мкм, длина и ширина составляли 10 и 1 мм соответственно. Условия отжига выбирались такими, чтобы пленки имели растянутый резистивный переход в сверхпроводящее состояние, охватывающий интервал  $T = 10 - 80$  К. При температурах ниже критической резистивное состояние достигалось током 1 – 10 мА и магнитным полем  $\sim 50$  кЭ, перпендикулярным плоскости пленки. Измерение времени энергетической релаксации проводилось с использованием биений колебаний 2 мм диапазона длин волн, генерируемых двумя лампами обратной волны (ЛОВ). Для изменения частоты биений  $f$  частота генерации одной из ЛОВ фиксировалась, а у другой изменялась в нужных пределах напряжением питания. Изменение напряжения  $\Delta U$  на образце под действием излучения (при фиксированном токе смещения) регистрировалось на частоте биений анализатором спектра в диапазоне 0,01 – 2 ГГц. (Более подробно методика измерений описана в<sup>1</sup>). Для исключения влияния частотной характеристики тракта регистрации вычислялось отношение значений  $\Delta U(f)$ , измеренных при двух температурах. На рисунке представлена зависимость  $\Delta U(f)$  при  $T = 1,6$  К, нормированная на ту же величину, измеренную при  $T = 4,2$  К. Эти данные показывают, что при  $T = 1,6$  К время релаксации  $\tau \approx 10^{-10}$  с.



Обсудим полученный результат. В довольно толстых пленках YBaCuO время ухода фона из пленки  $\tau_{es} \approx 4d/u \gtrsim 10^{-9}$  с ( $u$  – скорость звука), что значительно больше приведенного выше экспериментального значения  $\tau$ . Наблюдаемое постоянство  $\Delta U$  при  $f \lesssim f_0$ , где  $f_0 \approx \approx 1 \text{ ГГц} \gg (2\pi\tau_{es})^{-1}$ , и спад  $\Delta U$  в области больших частот могут реализовываться при выполнении условия  $\tau_{eph} < \tau_{es}, \tau_{phe}$  ( $\tau_{phe} = (C_{ph}/C_e)\tau_{eph}$  – время жизни фона, ограниченное электрон-фононным взаимодействием;  $C_{ph}$  и  $C_e$  – фоновая и электронная теплоемкости). Неравенство  $\tau_{eph} < \tau_{phe}$ , не выполняющееся в исследованной области температур для обычных сверхпроводящих металлов, может реализоваться в металлоксидных сверхпроводниках – как показали недавние эксперименты (см., например,<sup>2</sup>), в последних электронная теплоемкость на единицу объема существенно меньше. Если  $\tau_{eph}$  оказывается наименьшим из обсуждаемых времен, то независимо от соотношения между  $\tau_{es}$  и  $\tau_{phe}$  экспериментально измеряемое время  $\tau$ , соответствующее наиболее быстрому этапу энергетической релаксации, должно совпадать с  $\tau_{eph}$ . Действительно, если  $\tau_{es} < \tau_{phe}$ , фононы в пленке служат термостатом для электронов и релаксация описывается одним временем  $\tau_{eph}$ . При  $\tau_{eph} < \tau_{phe} < \tau_{es}$  теплоемкость фононной подсистемы много больше электронной и в силу этого на начальном этапе релаксации фононы также играют роль термостата.

В обычных сверхпроводящих металлах характерные значения  $\tau_{eph}$  при  $T \sim 1$  К составляют  $\sim 10^{-8}$  с. Время энергетической релаксации  $\tau_{eph}$ , найденное для соединения YBaCuO, оказывается значительно меньше, что, при сравнимых значениях температуры Дебая, указывает на существенное усиление ЭФВ в металлоксидных сверхпроводниках. Полученные резуль-

таты демонстрируют перспективность использования YBaCuO в качестве материала для различных быстродействующих криоэлектронных устройств.

### Литература

1. Гершензон Е.М., Гершензон М.Е., Гольцман Г.Н. и др. ЖЭТФ, 1984, 86, 758.
2. Orlando T.P., Delin K.A. et al. Phys. Rev. B, 1987, 35, 5347.

Московский педагогический  
институт им. В.И.Ленина

Поступила в редакцию  
15 июля 1987 г.